Einführung

- 1 Simulation von Halbleiterbauelementen
 - 1.1 Einführung
 - 1.2 Bauelementesimulator SIMBA
 - 1.3 Simulationsbeispiele
 - 1.4 SIMBA Eingabebefehle und Datenstruktur
 - 1.5 Belegaufgaben
 - 1.6 Transistorkenngrößen
- 2 Grundverfahren der Halbleitertechnologie
 - 2.1 Halbleitermaterial
 - 2.1.1 Elementare Halbleiter
 - 2.1.2 Verbindungshalbleiter
 - 2.1.3 Herstellung von Si-Halbleitermaterial
 - 2.2 Abscheideverfahren
 - 2.2.1 Überblick
 - 2.2.2 Oberflächenumwandlung
 - 2.2.3 Chemische Abscheideverfahren
 - 2.2.4 Epitaxie
 - 2.2.5 Physikalische Abscheideverfahren

2.3	Dotierungsverfahren
-----	---------------------

- 2.3.1 Dotierungsstoffe
- 2.3.2 Dotierung bei Epitaxie
- 2.3.3 Legierung
- 2.3.4 Diffusion
- 2.3.5 Ionenimplantation
- 2.3.6 Dotierung durch fokussierte Ionenstrahlen

2.4 Lithographie

- 2.4.1 Überblick
- 2.4.2 Photolithographie
- 2.4.3 Elektronenstrahllithographie
- 2.4.4 Röntgenstrahllithographie
- 2.4.5 Ionenstrahllithographie

2.5 Schichtabtragung

- 2.5.1 Überblick
- 2.5.2 Nassätzen
- 2.5.3 Trockenätzen
- 2.5.4 Abhebetechnik
- 2.5.5 Chemisch-mechanisches Polieren

- 2.6 Aufbau- und Verbindungstechnik
 - 2.6.1 Gehäusearten
 - 2.6.2 Chipmontage
 - 2.6.3 Kontaktierung
 - 2.6.4 Hybridtechniken
- 2.7 Spezielle Verfahren der Mikrosystemtechnik
 - 2.7.1 Silizium-Mikromechanik
 - 2.7.2 LIGA-Verfahren
 - 2.7.3 Alternative Verfahren der Mikrostrukturierung
- 2.8 Reinraumtechnik

- 3 Halbleiterbauelemente in integrierten Schaltkreisen
 - 3.1 Überblick
 - 3.1.1 Herstellungsablauf eines integrierten Schaltkreises
 - 3.1.2 Isolationstechnik
 - 3.2 Bipolare Technologien und Bauelemente
 - 3.2.1 Standard-Bipolar-Technologie
 - 3.2.2 Oxidisolations-Technologie
 - 3.2.3 Hochspannungs-, Leistungs- und Hochfrequenztransistoren
 - 3.2.4 Bipolare Logikschaltungen
 - 3.2.5 Hetero-Bipolartransistoren
 - 3.3 Unipolare Technologien und Bauelemente
 - 3.3.1 MOSFET-Technologien
 - 3.3.2 Prozessweiterentwicklungen
 - 3.3.3 Unipolare Logikschaltungen
 - 3.3.4 Hetero-Feldeffekttransistoren
 - 3.3.5 Weitere Heterostrukturen
 - 3.3.6 Organische Feldeffekttransistoren

4 Architekturen integrierter Schaltkreise

- 4.1 Überblick
- 4.2 Anwendungsspezifische integrierte Schaltungen
 - 4.2.1 Programmierbare Logikschaltungen
 - 4.2.2 Gate-Arrays
 - 4.2.3 Standardzellen-Schaltkreise
 - 4.2.4 Vollkunden-Schalkreise
- 4.3 Entwurfsablauf integrierter Schaltkreise
 - 4.3.1 Prinzipieller Entwurfsablauf
 - 4.3.2 Layoutentwurf
 - 4.3.3 Testverfahren

Literatur

- [1] A. Möschwitzer: Grundlagen der Halbleiter- & Mikroelektronik, Band 1 und 2 Carl Hanser Verlag München, 1992
- [2] H. Beneking: Halbleiter-Technologie B.G. Teubner Stuttgart, 1991
- [3] W. von Münch: Einführung in die Halbleitertechnologie B.G. Teubner Stuttgart, 1993
- [4] W. Menz, J. Mohr, O. Paul: Mikrosystemtechnik für Ingenieure WILEY-VCH Verlag Weinheim, 1993 u. 2005
- [5] A. Möschwitzer: Halbleiterelektronik, Wissensspeicher VCH Verlagsgesellschaft Weinheim, 1993
- [6] K. Kaiser, K. Hauptmann, W. Schäfer: Halbleitertechnologie Stand und Entwicklungstendenzen Hüthig Buch Verlag Heidelberg, 1989
- [7] H.-U. Post: Entwurf und Technologie hochintegrierter Schaltungen B.G. Teubner Stuttgart, 1989
- [8] A. Kemper, M. Meyer: Entwurf von Semicustom-Schaltungen Springer-Verlag Berlin, 1989
- [9] J. Siegl, H. Eichele: Hardware-Entwicklung mit ASIC Hüthig Buch Verlag Heidelberg, 1990
- [10] P. Ammon: ASIC-Praxis. Grundlagen und Anwendung anwendungsspezifischer ICs Franzis-Verlag München, 1989
- [11] K. Goser: Großintegrationstechnik Hüthig Buch Verlag Heidelberg, 1990
- [12] K. Unger, H.G. Schneider: Verbindungshalbleiter Akad. Verlagsgesellschaft Geest & Portig Leipzig, 1986

Literatur

- [13] K. Schade: Mikroelektroniktechnologie Verlag Technik Berlin, 1991
- [14] I. Ruge, H. Mader: Halbleiter-Technologie Springer-Verlag Berlin, 1991
- [15] H.-J. Hanke: Baugruppentechnologie der Elektronik Hybridträger Verlag Technik Berlin, 1994
- [16] P. Christiansen: Rechnergestütztes Entwickeln integrierter Schaltungen Vogel-Verlag Würzburg, 1989
- [17] W.-J. Fischer, R. Schüffny: MOS-VLSI-Technik Akademie-Verlag Berlin, 1987
- [18] U. Hilleringmann: Mikrosystemtechnik auf Silizium B.G. Teubner Stuttgart, 1995
- [19] U. Hilleringmann: Silizium-Halbleitertechnologie B.G. Teubner Stuttgart, 1999
- [20] D. Widmann, H. Mader, H. Friedrich: Technologie hochintegrierter Schaltungen Springer-Verlag Berlin, 1996
- [21] W. Prost: Technologie der III/V-Halbleiter Springer-Verlag Berlin, 1997
- [22] G. Gerlach, W. Dötzel: Grundlagen der Mikrosystemtechnik Carl Hanser Verlag München, 1997
- [23] U. Mescheder: Mikrosystemtechnik B.G. Teubner Stuttgart 2000
- [24] B. Hoppe: Mikroelektronik 1 und 2 Vogel Verlag Würzburg, 1997
- [25] H. Klar: Integrierte Digitale Schaltungen MOS / BICMOS Springer-Verlag Berlin, 1996

Literatur

- [26] P. Heusinger, K. Ronge, G. Stock: PLDs und FPGAs in der Praxis Franzis-Verlag Poing, 1994
- [27] A. Auer, D. Rudolf: FPGA Feldprogrammierbare Gate Arrays Hüthig Buch Verlag Heidelberg, 1995
- [28] N. Reifschneider: CAE-gestützte IC-Entwurfsmethoden Prentice Hall München, 1998
- [29] D.Jansen: Handbuch der Electronic Design Automation. Carl Hanser Verlag München, 2001
- [30] T. Giebel: Grundlagen der CMOS-Technologie B.G. Teubner Stuttgart 2002
- [31] T. Schulz: Konzepte zur lithographieunabhängigen Skalierung von vertikalen Kurzkanal-MOS-Feldeffekt-Transistoren und deren Bedeutung. Dissertation, Bochum 2001
- [32] W. Fahrner: Nanotechnologie und Nanoprozesse. Springer Verlag, Berlin 2003
- [33] K. Goser, P. Glösekötter, J. Dienstuhl: Nanoelectronics and Nanosystems. Springer Verlag, Berlin 2004
- [34] R. Waser: Nanoelectronics and Information Technology. Wiley-VCH Weinheim, 2003
- [35] S. Büttgenbach: Mikromechanik B.G. Teubner Stuttgart, 1994
- [36] F. Völklein, T. Zetterer: Praxiswissen Mikrosystemtechnik. Vieweg Verlag Wiesbaden, 2006
- [37] R. Brück, N. Rizvi, A. Schmidt: Angewandte Mikrotechnik. Carl Hanser Verlag München, 2001
- [38] F. Schwierz, J.J. Liou: Modern Microwave Transistors, Wiley & Sons 2003
- [39] J. Lienig: Layoutsynthese elektronischer Schaltungen. Springer-Verlag Berlin, 2006
- [40] S. Globisch et al: Lehrbuch Mikrotechnologie, Fachbuchverlag Leipzig, 2011